





REC'D 18 HA. 1996 WIPO PCT



Intyg C rtificat

Härmed intygas att bifogade kopior överensstämmer med de handlingar som ursprungligen ingivits till Patent- och registreringsverket i nedannämnda ansökan.

This is to certify that the annexed is a true copy of the documents as originally filed with the Patent- and Registration Office in connection with the following patent application.

- (71) Sökande A Ahlstrom Corp, Norrmark FI Applicant (s)
- (21) Patentansökningsnummer 9502087-1 Patent application number
- (86) Ingivningsdatum 1995-06-07
 Date of filing
- (30) Prioritet begärd från 95-02-17 FI 950749

Stockholm, 1996-02-27

För Patent- och registreringsverket For the Patent- and Registration Office

Asa Dallberg

Avgift Fee

170:-



Menetelmä peroksidilla valkaistavan massan esikäsittelemiseksi

1- 0-80 IU.41

5

10

15

30

Esillä olevan keksinnön kohteena on menetelmä massan valkaisemiseksi peroksidilla. Erityisesti keksinnön kohteena on peroksidivalkaisun vaatiman esikäsittelyn tehostaminen ja samalla yksinkertaistaminen.

Ennalta on tunnettua valkaista massaa peroksidilla monessa yhteydessä. Erikoisesti kloorivapaan massan valkaisun yhteydessä peroksidi on tärkeä. Peroksidivalkaisu vaatii, että ennen peroksidivalkaisua massasta poistetaan raskasmetallit hyväksi käyttäen esimerkiksi kompleksimuodostajia, joita ovat esimerkiksi EDTA tai DIPA. Kokelssa on todettu, että tässä ns. kelatointivaiheessa sopiva pH on 4 - 7, edullisesti 5 - 6.

Toisaalta on äskettäin yllättäen todettu, että massan kappaluku voidaan pudottaa pelkällä hapolla pH-alueelle 2 - 6, edullisesti 3 - 4. Lämpötilan tulee tässä ns. hapotuskäsittelyssä olla 60 - 130 °C ja aika 20 - 240 minuuttia. Sopiva happo on muurahaishappo, rikkihappo tai suolahappo, joskin muitakin happoja voidaan ajatella käytettävän. Happokäsittelyä voidaan tehostaa lisäkemikaaleilla.

Nămă vaiheet A (hapotus) ja Q (kelatointi) on usein luultu voitavan yhdistää, mutta käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että näin ei voida tehdä. Hapotuskäsittelyn pH ja kelatoinnin pH ovat eri alueilla ja siitä syystä vaaditaan kaksi eri käsittelytornia. Tämän keksinnön tarkoituksena on aikaansaada menetelmä hapotuksen ja kelatoinnin suortuamiseksi mahdollisimman yksinkertaisella tavalla ilman turhia pumppauksia.

Keksimiön mukaiselle menetelmälle tunnusmerkilliset seikat käyvät ilmi oheisista patenttivaatimuksista.

Seuraavassa keksinnön mukaista menetelmää kuvataan yksityiskohtaisemmin viittaamalla oheiseen kuvioon 1, joka esittää keksinnön erään edullisen suoritus-

20777322234. 4 0/14

muodon mukaisen laitejärjestelyn, jossa keksinnön mukaista menetelmää voidaan soveltaa.

Massa siirretään edeltävästä käsittelyvaiheesta 10 MC-pumpulla 12 happotorniin 14. Edeltävä käsittelyvaihe voi olla massan keittoa tavallisimmin seuraava happidelignifiointi, sitä seuraava pesu tai jokin muu delignifiointi- fai valkaisuvaihe tai sitä seuraava pesu. Ennen tornia 14 massan joukkoon lisätään tarvittavia kemikaaleja ja tarvittaessa lämpötilan nostamiseksi höyryä. Mainittuja kemikaaleja ovat jo edellä mainitut hapot sekä esimerkiksi entsyymit, magnesium ja/tai kalsium, jotka lisätään muodossa MgSO₄ ja/tai CaO. Kemikaalit on mahdollista lisätä joko suoraan pumppuun 12, injektoida pumpun 12 ja tornin 14 vällseen putkeen 16 tai erityiseen tarkoitusta varten järjestettyyn sekoittajaan 18. Olosuhteet happotornissa 14 ovat seuraavat: paine 0 - 20 bar, edullisesti 1 - 10 bar; lämpötila 70 - 130 °C, edullisesti 80 - 110 °C; ja pH 2 - 6, edullisesti 3 - 4. käsittelyaika happotornissa on 30 - 240 minuuttia, edullisesti 45 - 150 minuuttia. Kappaluku laskee happotornissa tavallisesti noin 1 - 9 yksikköä.

Happokäsittelyn jälkeen massaan lisätään kelatoinnissa tarvittavat kemikaalit. Näitä ovat kompleksimuodostaja, esimerkiksi EDTA ja DTPA, ja mahdolliset metallit kuten magnesium ja kalkki. Metallit voivat edesauttaa kelatointia. Myös entsyymejä voidaan käyttää. Kelatoinnissa pyritään poistamaan vetyperoksidin hajoamista katalysoivia raskasmetalleja, kuten esimerkiksi mangaani ja kupari. Sopiva pH kelatoinnille on 4 - 7, edullisesti 5 - 6. Mikäli pH on hapotuksen jälkeen kelatoinnille sopimattomalla alueella, pH säädetään sopivaksi lisäämällä happoa tai alkalia (NaOH). Yleensä NaOH:ta joudutaan lisaamään pH:n kohottamiseksi hapotuksessa vallinneelta matalammalta tasolta. Sopiva lisäyspaikka näille eri kemikaaleille on hapotus- eli ns. A-tornin 14 poistopurkain 20 tai sitä seuraava siirtolinja 22 hapotus- ja kelatointitornien 14, 24 välillä. Osa kemikaaleista voidaan lisätä jo A-vaiheeseen esim. MgSO₄, EDTA, DTPA - pääasia on, että ne ovat läsnä, kun tullaan Q-vaiheeseen ja nostetaan pH.

10

15

20

25

30

A-tornin 14 tai itse asiassa syöttöpumpun 12 kehittämällä paineella massa siirretään Q-torniin 24. Täten A- ja Q-vaiheille käytetään kahta eri tornia 14 ja 24 ilman, että tornien välille tarvittee järjestää pumppausta. Massan poistopurkain 20 voidaan larvittaessa suunnitella sellaisoksi, ottä so sokoittaa kemikaaleja ja/tai nostaa painetta. Kuviossa 1 A-torni 14 on ylösvirtaava ja samoin Q-torni 24. Mainitut tornit 14 ja 24 voivat olla joko ylös- tai alasvirtaavia riippuen tilanteesta. Massan voi myös eräissä tapauksissa siirtää pelkän painovoiman avulla Atornista Q-torniin.

Q-tornissa 24 massa kelatoidaan, Olosuhteet ovat seuraavat: käsittelyaika vähintään 10 - 60 minuuttia pH:n ollessa alueella 4 - 7, edullisesti 5 - 6. Lämpötilalla ja paineella ei ole todettu olevan merkittävää vaikutusta kelatointitapahtumaan, joskin Q-torni voi olla painelstettu. Kasluelyalkakaan el Q-tornissa 24 ole kriittinen, vaan se voi olla jopa useita tunteja edellämainittua pitempi esimerkiksi silloin, kun Q-tornia 24 käytetään massan varastotornina, eli tavallisena sakeamassatornina.

Q-tornin 24 jälkeen massa pestään ja/tai puristetaan. Puristamisella tarkoitetaan pesutapaa, jossa esimerkiksi tornista 24 keskisakeudessa 10 - 14 % tulevasta massasta puristetaan nestettä ja sen mukana hapotus- ja kelatointikäsittelyissä massasta nesteeseen liuenneita ja uuttuneita sekä erilaisissa reaktioissa syntyneitä aineita niin, että massan sakeus kohoaa > 30 %, jonka jälkeen massa laimennetaan takaisin keskisakealle alueelle. Kuviossa 1 on esitetty pesuri 28, johon massa puretaan tornista 24 joko tornin 24 palneella tal palnetta nostavan pohjapurkaimen 26 avulla ts. joka tapauksessa ilman erillistä pumppua. Pesuri 28 on edullisesti ns. fraktioiva pesuri, joka tarkolttaa sitä, ellä samasta pesurista saadaan useampia väkevyydeltään erilaisia suodoksia. Tällainen (raktioiva pesuri on ns. DrumDisplacer-pesuri, jota käsitellään mm. US patenttijulkaisuissa 4,919,158 ja 5,116,423. Pesurissa 28 syntyvistä suodoksista yksi, edullisesti raskasmetallirikas, suodos F1 poistetaan putkea 30 pitkin ja toinen F2 palautetaan putkea 32 pitkin esimerkiksi A-vaihetta edeltävälle pesurille. Täten AQ-vaihe on osittain suljettu.

9 9 502229

22293339;# 5/14

resurilla 20 suoritetun pesun jälkeen massa valkaistaan perokeidilla. Edullista on käyttää paineellista reaktoria, erityisesti kaksiastiareaktoria, kuten kuviossa 1 on esitetty. Reaktorityypistä riippumatta sopiva peroksidiannos on 5 - 20 kg H₂O₂/adt ja happea voi kappatasosta riippuen lisätä 0 - 15 kg/adt, edullisesti noin 5 kg/adt. Peroksidivaiheeseen lisätään myös alkalia pH:n nostamiseksi ja tarvittaessa magnesiumia esimerkiksi magnesiumsulfaatin muodossa. Lämpötila on 90 - 130 °C. Peroksidivaihetta voi edeltää jokin muu valkaisuvaihe esim. ZQ-vaihe.

5

20

25

30

Kaksiastiareaktoria hyväksikäyttävässä menetelmässä massa pumpataan NC-sakeudessa MC-pumpulla 32, haluttaessa sekoittimen 34 kautta esireaktoriin 36, joka on mitoitettu käsittelyajalle 10 - 60 minuuttia. Paine reaktorissa on 3 - 20 bar, edullisesti noin 10 bar. Valkaisukemikaalit H₂O₂ ja happi syötetään pumpulle 32 tai sekoittimeen 34. Peroksidiannos on 5 - 20 kg/adt, edullisesti noin 10 kg/adt. Happiannos on yleensä 0 - 15 kg/adt, edullisesti noin 0 - 10 kg/adt, edullisemmin noin 3 - 5 kg/adt. Lämpötila on 80 - 110 °C, edullisesti 90 - 100 °C.

Esireaktorissa 36 peroksidi reagoi nopeasti ja noin 30 minuutin jälkeen on 75 % peroksidista kulunut. Tämä tarkoittaa myös sitä, että 75 % reaktiokaasuista on syntynyt. Tämän ajatuksen mukaisesti installoidaan esireaktorin 36 huipulle kaasunerotin 38, joka erottaa reaktorin 36 palnetilasta kaasua. Tällaisen laitteen 38 erotuskyky on 40 - 90 % massassa olevasta kaasumäärästä. Kaasunerotuksen jälkeen vielä paineellinen massa viedään putkea 40 pitkin itse valkaisutornin 44 pohjaan, jossa massa oman paineensa avulla virtaa ylöspäin ilman erillistä pumppua. Valkaisutornin 44 ei välttämättä tarvitse olla paineellinen, vaan se voi hyvin olla mikä tahansa tehtaan jo olemassaoleva sopivan kokoinen säiliö. Edullista kuitenkin on pitää valkaisutornissa 44 lievä ylipaine eli paine alueella 1.1 - 5 bar. Sopiva viipymääika tornissa 44 on 30 - 200 minuuttia. Lisäkemikaaleja voidaan tuoda massaan tornien 36 ja 44 välissä joko sekoittimen (ei esitetty) kautta tai esimerkiksi injektoituna. Valkaisureaktioiden päätyttyä massa on tornin 44 huipulla ja virtaa korkeuseron avulla seuraavaan käsittelyvaiheeseen ilman

pumppua. Tornin 44 ollessa paineistettu voidaan tornin 44 poistoaukko varustaa kaasunerottimella 46, jolla peroksidireaktiossa syntyneitä kaasuja poistetaan ja, mikäli kaasunerotin on painetta kohottava, jonka kehittämää lisäpainetta hyväksikäyttäen massa syötetään edelleen.

5

25

30

Keksinnön mukaista menetelmää soveltavista mahdollisista sokvensseistä ovat edullisimmiksi osoittautuneet seuraavat:

Keitto - O - AQ - P (vaaleus yli 80), 10 Keitto - AQ - ZP (vaaleus yli 83), Keitto - O - AQ- P - AQ - P -(vaaleus yll 83), Keitto - O - AQ - P - ZQ - P (vaaleus yli 88), Keillo - O - AQ - ZQ - P - ZP (vaaleus yli 88), Keitto - O - AQ - P - ZP (vaaleus yli 88), ja Keitto - O - AQ - ZQ - P 15 (vaaleus yli 85), joissa P voi olla hapella vahvistettu peroksidivaihe Po, johon peroksidiannostus on yli 10 kg H₂O₂/adt, ja happiannostus 0 - 10 kg O₂/adt, tai peroksidilla vahvistettu happivaihe Op, johon peroksidisannostus on alle 10 kg H₂O₃/adt ja happiannostus yli 5 kg O₂/adt, edullisesti 5 - 15 kg/adt. Useampia peroksidivaiheita P käsit-20 tävässä sekvenssissä tulisi edullisesti ensimmäisen P-vaiheen olla peroksidilla vahvistettu happivaihe Op ja jälkimmäisen hapella vahvistettu peroksidivaihe Po. Peroksidivaihe voi olla myös hapan P-vaihe, jolloin valkaisu tapahtuu Caro'n hapolla tai perhapolla.

Yllä mainittuja sekvenssejä voldaan yksinkertaistaa jättämällä pois pesureita.

Prosessin kannalta ei ole aina välttämätöntä pestä ennen A, Q tai AQ vaiheita.

Tosin hapon kulutus lisääntyy, mutta tämä ei aina ole liian kallista verrattuna pesurin hintaan. Täten merkintä "-", joka tavallisesti indikoi pesua ja/tai puristusta voidaan jättää pois ennen A ja/tai Q-vaiheita. Täten esimerkiksi osasekvenssi P-AQ korvataan osasekvenssillä PAQ, tai mahdollisesti PA tai PQ.

Siten myös sekvenssit kuten esimerkiksi

Keitto - O - AQ - PQ - P Keitto - O - AQ - PQ - ZP

Keitto - O - AQ - ZPQ - ZP

Keltio - O - PAQ - P

tulevat kyseeseen.

5

10

15

20

25

30

(vaaleus yli 88), (vaaleus yli 88), (vaaleus yli 88), ja (vaaleus yli 85)

Toinen yksinkertaistaminen, mikä joskus kannattaa tehdä, on korvata ZQ pelkällä Z:lla. Tämä silloin, kun metallinpoisto muutenkin on riittävän hyvä. Milloin sekvenssissä on kaksi AQ vaihetta, toinen vaiheista, edullisesti ensimmäinen, voidaan korvata joskus pelkällä A-vaiheella.

A-vaihetta voidaan tehostaa lisäämällä siihen jokin valkaisua edistävä kemikaali tai valkaisukemikaal. Tälläinen kemikaali voi olla esimerkiksi jokin entsyymi tai klooridioksidi. A-vaihe voi silloin olla A_{Entsyymi} (A_E) tai A_{Dioksidi} (A_D). Milloin A-vaiheeseen lisätään entsyymlä, sopiva ph on 4 - 5 ja sopiva lämpötila 60 - 80 °C. Milloin A-vaiheeseen lisätään klooridioksidia, sopiva loppu ph on 3 - 5 ja alku pli vähän (2 - 3 yksikköä) korkeampi. Lämpötila on dioksidia käytettäessä sopivasti 80 - 100 °C. Milloin lisätään klooridioksidia voi olla aiheellista tuhota klooridioksidijäännökset SO₂:lla/tai NaOH:lla ennen kelatointiaineen lisäämistä, jottei kelatointiaine tuhoutuisi. Yllämainituissa sekvensseissä voi A siten olla A_E tai A_D tai mahdollinen muu tehostettu A-vaihe.

Kuten edellä esitetystä huomataan, on keksinnön mukainen peroksidivaihetta edeltävä käsittelyvaihe hyvin yksinkertainen ja toisaalta myös tehokas. Koska kumpikin käsittelyvaihe suoritetaan juuri tarkalleen vaiheen vaatimassa pH:ssa, on vaiheiden tehokkuus saatu maksimoitua. Kuitenkin esikäsittelyvaiheen/-vaiheiden paineistuksella on saatu aikaan se, että laitteistoinvestoinnit jäävät suhteellisen pieniksi, koska pumppujen määrä on saatu mahdollisimman pieneksi. Myös joihinkin aiempiin ehdotuksiin verrattuna keksintömme mukainen menetelmä säästää yhden pesurin verran, koska ennen ehdotettiin pesuvaihetta myös hapotus- ja kelatointivaiheiden välille. Kuitenkin on huomattava, että edellä keksinnöstämme on esitetty vain muutamia edullisla suoritusmuotoja, Jotka ovat

10

25

30

7

esimerkinomaisia eivätkä millään muotoa ole tarkoitettu rajoittamaan keksintömme suojapiiriä, joka on esitetty oheisissa patenttivaatimuksissa.

Patenttivaatimukset

- 1. Menetelmä peroksidilla valkaistavan massan esikäsittelemiseksi hapotuksella ja kelatoinnilla, tunnettu siitä, että
- a) massa syötetään sakeuden ollessa 8 20 % paineelliseen happotorniin (14), jossa paine on 0 20 bar, edullisesti 1 10 bar ja lämpötila 60 130 °C,
- b) massa käsitellään happotornissa (14) 20 240 minuuttia kappaluvun pudottamiseksi ja valkaistavuuden parantamiseksi pH:ssa 2 6, edullisesti pH:ssa 3 4,
- 15 c) massa siirretään happotornista (14) kelatointitorniin (24),
 - d) massaa käsitellään kompleksimuodostajalla vähintään 10 60 minuuttia pH:n ollessa 4 7, edullisesti 5 6, ja
 - e) massa pestään ja/tai puristetaan.
- 20 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, <u>tunnettu</u> siitä, että vaihetta e) seuraa peroksidivalkaisuvaihe f).
 - 3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, <u>tunnettu</u> siltä, että massan pH säädetään tarvittaessa lisäämällä happoa tai alkalia massaan b) ja d) vaiheiden välillä yleensä tai c)-vaiheessa.
 - 4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, <u>tunnettu</u> siitä, että magneslumla ja/tai kalsiumia ja/tai entsyymejä ja/tai klooridioksidia lisätään ennen hapotus- ja/tai kelatointivaihetta tai niiden yhteydessä.
 - 5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, <u>tunnettu</u> siitä, että vaiheessa e) massa pestään fraktioivalla pesurilla (28) siten, että raskasmetalleja

15

25

AWAPATEN

sisältävä suodos F1 polstetaan prosessista ja puhtaampi suodos F2 palautetaan käytettäväksi jossakin toisessa prosessivaiheessa.

- 6. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että vaiheen f) peroksidivalkaisu toteutetaan kahdessa erikokoisessa yhteenkytketyssä tornissa (14, 24), joista ensimmäinen on ns. esireaktori (14) ja toinen ns. valkaisutorni (24).
- 7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että peroksidivalkaisuvaiheessa
 - sekoitetaan massan joukkoon ainakin peroksidia,
 - syötetään massa paineelliseen esireaktoriin (14), jossa paine on 3 20 bar ja vilpymäalka 10 60 min,
 - annetaan massan reagoida peroksidin kanssa niin pitkälle, että vielä jäljellä oleva peroksidimäärä on korkeintaan 5 kg H₂O₂ massatonnia kohti,
 - erotetaan kaasua massasta sen ollessa yli 3 bar'in paineessa erotetun kaasumäärän ollessa 40 - 90 % massassa olevasta kaasumäärästä,
 - työnnetään esireaktorin (14) paineella massa valkaisutornin (24) alaosaan, josta massa virtaa ylöspäin, ja
- 20 poistetaan massa valkaisutornin (24) huipusta.
 - 8. Patenttivaatimuksen 2 tai 7 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että peroksidiannostus valkaisuvaiheeseen on 10 20 kg/adt ja happiannostus 0 10 kg/adt, jolloin on kyseessä hapella vahvistettu peroksidivaihe Po.
 - 9. Patenttivaatimuksen 2 tai 7 mukainen menetelmä, <u>funnettu</u> siitä, että peroksidiannostus valkaisuvaiheeseen on alle 10 kg/adt ja happiannostus yli 5 15 kg/adt, jolloin kyseessä on peroksidilla vahvistettu happivaihe Op.
- 10. Patenttivaatimuksen 6 tai 7 mukainen menetelmä, <u>tunnettu</u> siitä, että paine valkaisutornissa on 0 5 bar, edullisesti 1.1 5 bar ja lämpötila 80 130 astetta.

15

- 17. Patenttivaatimuksen 2 tai 7 mukainen menetelmä, <u>tunnettu</u> siitä, että peroksidivaihe on hapan, jolloin valkaisu suoritetaan perhapolla tai Caro'n hapolla.
- 5 12. Patenttivaatimuksen 2 tai 7 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että peroksidivaihe on alkalinen ja valkaisu suoritetaan vetyperoksidilla.
 - 13. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 7 mukaisen käsittelyn käyttö valkaisekvenssissä keitto O AQ P massan valkaisemiseksi vaaleuteen yli 80 ISO.
 - 14. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 7 mukaisen käsittelyn käyttö valkaisusekvenssissä keitto AQ ZP massan valkaisemiseksi vaaleuteen yli 83 ISO.
 - 15. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 7 mukaisen käsittelyn käyttö valkaisusekvenssissä keitto O AQ P AQ P massan valkaisemiseksi vaaleuteen yli 83 ISO.
- 20 16. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 7 mukaisen käsittelyn käyttö valkaisusekvenssissä keitto - O - AQ - P - ZQ - P massan valkaisemiseksi vaaleuteen yli 88 ISO.
- 17. PatenttivaatImuksen 1, 2 tai 7 mukaisen käsittelyn käyttö val-25 kaisusekvenssissä keitto - O - AQ - ZQ - P - ZP massan valkaisemiseksi vaaleuteen yli 88 ISO.
- 18. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 7 mukaisen käsittelyn käyttö valkaisusekvenssissä keitto - O - AQ - P - ZP massan valkaisemiseksi vaaleuteen yli 30 88 ISO.

20

- 19. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 7 mukaisen käsittelyn käyttö valkaisusekvenssissa keltto O AQ ZQ P massan valkaisemiseksi vaaleuteen yli 85 ISO.
- 5 20. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 7 mukaisen käsittelyn käyttö valkaisusekvenssissä keitto OΛQ P massan valkaisemiseksi vaaleuteen yli 80 ISO.
- 21. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 7 mukaisen käsittelyn käyttö val-10 kaisusekvenssissä keitto - OAQ - P - AQ - P massan valkaisemiseksi vaaleuteen yli 83 ISO.
 - 22. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 7 mukaisen käsittelyn käyttö valkaisusekvenssissä keitto OAQ PAQ P massan valkaisemiseksi vaaleuteen yli 83 ISO.
 - 23. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 7 mukaisen käsittelyn käyttö val-kaisusekvenssissä keitto O AQ PAQ P massan valkaisemiseksi vaaleuteen yli 83 ISO.
 - 24. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 7 mukaisen käsittelyn käyttö valkaisusekvenssissä keitto O AQ PQ P massan valkaisemiseksi vaaleuteen yli 88 ISO.
- 25. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 7 mukaisen käsittelyn käyttö valkaisusekvenssissä keitto O AQ PQ ZP massan valkaisemiseksi vaaleuteen yli 88 ISO.
- 26. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 7 mukaisen käsittelyn käyttö val-30 kaisusekvenssissä keitto - O - AQ - ZPQ - ZP massan valkaisemiseksi vaaleuteen yli 88 ISO.

- 27. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 7 mukaisen käsittelyn käyttö valkaisusekvenssissä koitto O PAQ P massan valkaisemiseksi vaalenteen yli BS ISO.
- 28. Patenttivaatimuksen 15, 16, 21, 22, 23 tai 24 mukainen valkaisusekvenssi, tunnettu siitä, että järjestyksessä ensimmäinen P-vaihe on peroksidilla vahvistettu happivaihe Op ja järjestyksessä toinen P-vaihe on hapella vahvistettu peroksidivaihe Po, jolloin peroksidiannostus vaiheeseen Po on 10 20 kg/adt ja liappiannostus 0 10 kg/adt, ja peroksidiannostus vaiheeseen Op on alle 10 kg/adt ja happiannostus yli 5 15 kg/adt.
 - 29. Patenttivaatimuksen 13 28 mukainen valkaisusekvenssi, <u>tunnettu</u> siitä, että A-vaiheessa käytetään entsyymejä ja/tai klooridioksidia.

- 0-95 IV.41 , A. AHDSTKOM CORP PATENT DEPT. AWAPATEMI 9527293339;#13/14

(57) TIIVISTELMÄ

Esillä olevan keksinnön kohteena on menetelmä peroksidilla valkaistavan massan esikäsittelemiseksi hapotuksella ja kelatoinnilla. Erityisesti keksinnön kohteena on peroksidivalkaisun vaatlman esikäsittelyn tehostaminen ja samalla yksinkertaistaminen.

Keksinnön mukaiselle menetelmälle on ominaista, että massa syötetään sakeuden ollessa 8 - 20 % paineelliseen happotorniin (14), jossa paine on 0 - 20 bar, edullisesti 1 - 10 bar ja lämpötila 60 - 130 °C, massa käsitellään happotornissa (14) 20 - 240 minuuttia kappaluvun pudottamiseksi ja valkaistavuuden parantamiseksi pH:ssa 2 - 6, edullisesti pH:ssa 3 - 4, massa siirretään happotornista (14) kelatointitorniin (24), massaa käsitellään kompleksimuodostajalla vähintään 10 - 60 minuuttia pH:n ollessa 4 - 7, edullisesti 5 - 6, ja massa pestään ja/tai puristetaan.

(Fig. 1)

